This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

011617026

WPI Acc No: 1998-034154/199804

XRPX Acc No: N98-027373

Image region illuminating mask for flexographic print plate e.g. volcano

film - has light modifier arranged relative to transparent and

non-transparent regions for illumination modification and jitter effect compensation

Patent Assignee: CREO PROD INC (CREO-N)

Inventor: GELBART D

Number of Countries: 002 Number of Patents: 002

Patent Family:

Patent No. Kind Date Applicat No Kind Date Week DE 19723618 DE 1023618 A1 19971211 19970605 199804 B Α JP 10073912 19980317 JP 97163455 19970605 199821 łΑ

Priority Applications (No Type Date): US 96658785 A 19960605 Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes DE 19723618 A1 7 G03F-001/14

6 G03F-001/00 JP 10073912 Α Abstract (Basic): DE 19723618 A

The mask has transparent and non-transparent regions for use in illuminating an image region on a flexographic print plate with imaging light. The plate has a polymer responsive to imaging light to form illuminated regions. The mask (5) has a light modifier (9). This is arranged relative to the transparent and non-transparent areas to modify the illumination and to compensate jitter effects. The light modifier (9) is preferably arranged on the mask (5) in regions of

smaller, separate structures.

The method of forming such a mask (5) involves determining structure elements which make correction for jitter or insulation necessary. Light modifiers (9) are formed on the mask (5). The mask is then illuminated with mask imaging radiation.

USE - For image taken using high power UV light e.g. DDTFL.

ADVANTAGE - Provides improved system for illuminating whole flexographic print plate with single illumination process. Dwg. 2/4

Japanese Patent Provisional Publication No. 10-73912/1998

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-73912

(43)公開日 平成10年(1998) 3月17日

(51) Int.Cl. ⁶		微別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
G03F	1/00			G03F	1/00	D	
B41C	1/00			B41C	1/00		

審査請求 有 請求項の数33 FD (全 6 頁)

(71)出願人 393025183 (21)出願番号 特顯平9-163455 クレオ プロダクツ インコーポレイテッ (22)出顧日 平成9年(1997)6月5日 CREO PRODUCTS INC. カナダ国 プリティッシュ コロンピア州 (31)優先権主張番号 08/658, 785 ヴィ5ジー 4エム1, パーナピイ, ギ (32)優先日 1996年6月5日 (33)優先権主張国 米国 (US) ルモア ウェイ 3700 (72)発明者 ダニエル ゲルバート カナダ ヴィ6ジェイ 4エル2, ブリテ ィッシュ コロンピア, パンクーパー, パ

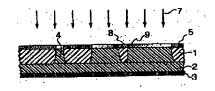
(74)代理人 弁理士 飯田 伸行

(54) 【発明の名称】 フレキソ印刷版の露光用マスク

(57)【要約】

【課題】 完全なフレキソ印刷版を1回の露光で露光できるように、調光体をもつ改良マスクを提供すること、および現在可能な解像度よりも高い解像度でフレキソ印刷版を製版することである。

【解決手段】 フレキソ印刷版露光用マスク5は、標準的な2元画像のほかに、透明部および不透明部、およびフレキソ印刷版への光の進行を調節して歪曲効果を補償するために、これら透明部および不透明部に対して設けた調光体9を有する。マスクによって補償する歪曲には、近接効果による歪曲や、印刷版の非画線部となる分離された微小部分による歪曲がある。



イン クレセント 4688

【特許請求の範囲】

【請求項1】 撮像光に応答して露光された部分を形成するフォトポリマーを有するフレキソ印刷版の画線部を 撮像光で露光するさいに使用する、透明部および不透明 部をもつマスクにおいて、

光の進行を調光して、歪曲効果を補償するために、上記マスク上に、上記の透明部および不透明部に対して調光体を設けたことを特徴とする露光用マスク。

【請求項2】 上記マスク上の上記調光体が、上記印刷版の非画線部となる分離された微小部分による歪曲効果を補償する請求項1記載のマスク。

【請求項3】 上記調光体が、上記透明部と不透明部と の間に位置決めできる歪曲境界位置で、近接効果および 角部による歪曲を補償して、撮像光への露光後歪みのな い画像を形成できるようにした請求項1記載のマスク。

【請求項4】 上記調光体が、撮像光を減衰する変調された部分であって、上記印刷版上のフォトポリマーの解像力よりも十分に小さい変調作用をもつ変調された部分である請求項1記載のマスク。

【請求項5】 上記変調された部分が、独立した画素網点のランダムな分散体である請求項4記載のマスク。

【請求項6】 上記印刷版上に上記マスクを一体的に形成した請求項1記載のマスク。

【請求項7】 上記マスクを熱によって活性化した請求項6記載のマスク。

【請求項8】 上記熱を赤外レーザーエネルギーによって供給する請求項7記載のマスク。

【請求項9】 上記印刷版とは別体のフィルム上に上記マスクを一体的に形成した請求項1記載のマスク。

【請求項10】 上記フィルムを熱によって活性化した 請求項9記載のマスク。

【請求項11】 上記熱を赤外レーザーエネルギーによって供給する請求項10記載のマスク。

【請求項12】 上記撮像光が紫外光である請求項1記 載のマスク。

【請求項13】 上記調光体が、上記マスクの選択された部分に位置決めされた透明部および不透明部に対して中間的な不透明度をもつ部分光吸収体であって、歪曲効果を補償して、撮像光への露光後歪みのない画像を形成できる部分光吸収体である請求項1記載のマスク。

【請求項14】 上記調光体が、上記印刷版の非画線部になるある一つの部分の第2部分への近接による歪曲効果を補償する請求項13記載のマスク。

【請求項15】 上記調光体が、上記透明部と不透明部との間に位置決めできる歪曲境界位置で、近接効果および角部による歪曲を補償して、撮像光への露光後歪みのない画像を形成できるようにした請求項14記載のマスク。

【請求項16】 上記印刷版上に上記マスクを一体的に 形成した請求項13記載のマスク。 【請求項17】 上記マスクを熱によって活性化した請求項16記載のマスク。

【請求項18】 上記熱を赤外レーザーエネルギーによって供給する請求項17記載のマスク。

【請求項19】 供給された熱に応じて、撮像光の減衰が可変化する請求項17記載のマスク。

【請求項20】 上記印刷版とは別体のフィルム上に上記マスクを一定的に形成した請求項13記載のマスク。

【請求項21】 上記フィルムを熱によって活性化した 請求項20記載のマスク。

【請求項22】 上記熱を赤外レーザーエネルギーによって供給する請求項21記載のマスク。

【請求項23】 供給された熱に応じて、撮像光の減衰が可変化する請求項21記載のマスク。

【請求項24】 上記マスクが、上記印刷版の非画線部となる分離された微小部分による歪曲効果を補償する請求項13記載のマスク。

【請求項25】 上記調光体が、上記印刷版の非画線部になる分離部分周囲のリングで、該リングの紫外光濃度が上記部分に隣接する部分の約0.2から該リングの縁部の0.1の範囲にある請求項24記載のマスク。

【請求項26】 上記リングの幅がほぼ1 mmである請求項25記載のマスク。

【請求項27】 上記フィルムがハロゲン化銀フィルム である請求項13記載のマスク。

【請求項28】 歪曲を補償する、フォトポリマーをも つ感光性フレキソ印刷版用のマスクを製作する方法にお いて、

- (a) 歪曲や分離を補償するのに必要な、印刷版の非画 線部となる部分を決定し、
- (b) 上記補正に必要なマスク上に調光体を形成し、そ 1 て
- (c) 上記マスクをマスク撮像光線で露光することからなることを特徴とするマスクの製作方法。

【請求項29】 上記調光体が、上記マスクの透明部と不透明部との間に位置決めされる調節された境界位置を有し、近接効果および角部による歪曲を補償できるようにした請求項28記載の方法。

【請求項30】 上記調光体が、上記印刷版の非画線部となる部分の周囲に設けられ、歪曲を補償する可変減衰体を有する請求項28記載の方法。

【請求項31】 上記調光体が、上記印刷版の非画線部となる部分および歪曲補正が必要な部分の周囲の光画素網点の不規則な分散体を有し、該画素網点の解像度が上記感光性フレキソ印刷版上のフォトポリマーの解像度よりも十分に小さい請求項28記載の方法。

【請求項32】 上記マスクを上記フレキソ印刷版と一体的に形成した請求項28記載の方法。

【請求項33】 上記印刷版とは別体のフィルム上に上記マスクを形成した請求項28記載の方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は印刷、特にフォトポ リマー型フレキソ印刷版の製版方法に関する。

[0002]

【従来の技術】フォトポリマーを使用して、フレキソ印 刷版を製版する場合、フォトポリマー上にマスクを設け る。フォトポリマーは固体状でもよく、液体状のフォト ポリマーでもよい。数分間、フィルムを介して高エネル ギー紫外(UV)光でフォトポリマーを露光する。マス クの透明部では、UV光がフォトポリマーを透過し、こ れを硬化(架橋)する。画像部毎に露光を変えると、最 善な結果が得られる。例えば、広い透明部で囲まれたフ ィルム上のある一つの網点は過剰露光に過敏である。と いうのは、光量が多すぎると、網点下のポリマーに漏光 するため、この網点が消失するからである。フィルム上 の黒色部が印刷版の非画線部になる。というのは、ポリ マーが硬化しないため、処理時に、洗い流されたり、あ るいは除去されるからである。フィルムの大きな黒色部 の中心にあるある一つの透明な網点については、これと は逆になる。即ち、透明な網点は露光が十分ではない。 この問題はよく知られている問題で、露光過程時にたく まずして微妙に動き回る不透明物質の小片をマスクとし て使用して解決するのが一般的である。これは時間のか かる技術だけでなく、熟練オペレータがメインマスク上 に小さな遮光マスクを設け、露光中の適当な時点でこれ らマスクを外す必要がある。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、完全なフレキソ印刷版を1回の露光で露光できるように、調光体をもつ改良マスクを提供することである。また、本発明の別な目的は、現在可能な解像度よりも高い解像度をもつフレキソ印刷版を製版することである。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明は、フォトポリマーを有するフレキソ印刷版を撮像光線で露光するさいに使用する、透明部および不透明部、およびこれら透明部および不透明部に対して調光体を有するマスクを提供するものである。

[0005]

【作用】調光体は、フレキソ印刷版のフォトポリマーへの光の進行を調節し、歪曲効果を補償する。この歪曲効果は、分離または近接効果における、印刷版の非画線部となる微小部分の結果と考えられる。

【0006】近接関係にある上記微小部分による歪曲は、歪曲された境界位置としてマスクに調光体を形成することによって補正することができる。

【0007】分離状態にある上記微小部分による歪曲は、分離状態にある上記微小部分それぞれの周囲にリングとして調光体を形成することによって補正することが

できる。このリングは上記微小部分に隣接する部分の光 学濃度が高く、そして光学濃度はリングの縁部にむかっ て低くなる。

【0008】フォトポリマーの解像力よりも十分に小さいため、撮像光を全体として減衰できるマスク内の変調作用を使用して、歪曲または上記の分離された微小部分を補正することができる。

【0009】マスクは印刷版と一体的に設けてもよく、 あるいは別体として設けてもよい。また、マスクは熱活 性化することもでき、この場合には赤外レーザーエネル ギーによって熱を供給することができる。

【0010】調光体としては、不透明度が透明部と不透明部の中間にある部分光減衰体を使用することができる。減衰量は、供給される熱の量に比例する。

【0011】本発明は、また、歪曲補正が必要な部分、および必要な光減衰または光強化を決定することからなる、フレキソ印刷版をフォトポリマーでマスクする方法を提供するものである。マスク上の部分に調光体を形成して、歪曲補正を行なってから、マスクを介してフレキソ印刷版を撮像光で露光する。

[0012]

【発明の実施の形態】図1および図2について説明する。フレキソ印刷版はフォトポリマー層1と、(組成が層1と同じでもよい)弾性層2と、寸法安定性を強化する支持層3とからなる。支持層3は、例えば、高分子材料でもよいが、金属層も使用することができる。平行UV光7を使用して、フィルム、即ちマスク5を介して印刷版を露光する。場合によっては、非平行光も使用できるが、高品質網版法では、平行光を使用する必要がある。特性を最適化するためには、画像の異なる部分(例えば、ハイライトおよびシャドー)毎に露光量を変える必要がある。今までは、(図1に6で示す)不透明な物体を使用して、露光量を少なくする必要のある部分を露光時に遮光することによってこれを行なっていた。不透明な物体6をどの位置にどの位の時間設けるかには、相当な技術が必要であった。

【0013】本発明の好適な実施態様では、この場合光減衰体または部分光吸収体である調光体9をフィルム5中に形成する。フィルムの形成時に、この調光体の位置および濃度を計算する。全体的な原理についていえば、印刷版の非画線部となる、マスク上の分離された微小部分周囲の透明部が減衰を必要とする。このように、印刷された頁上の、分離された部分周囲のハイライト部(マスク上の透明部下の印刷版の部分に相当するハイライト部)が必要とする光量は、それ以外のハイライト部が必要とする光量よりも少なくなる。ごく簡単な基準に照らしても、ハイライト部における露光量が30%~50%低下ことは大きな改善である。調光体9の位置および濃度をより正確に計算するためには、光重合を正確にモデル化すればよい。このためには、例えば、PROLIT

H3D (TM) として知られている市販のプログラムを使用することができる。減衰については、予め計算し、フィルムに組込んであるため、露光を最適化するために、労力や判断は必要ない。本発明を使用すると、微小な非画線部8の"プラギング"がなくなるため、スクリン線数を大きく取ることができる。

【0014】フィルム5として通常のフィルム(ハロゲ ン化銀)を使用した場合には、網版法によって要求され るような高いシャープネスを得ることが難しく、同時に 減衰を可変化 (グレースケール) することも難しいの で、本発明を実用化するのはいくぶん難しいかもしれな い。しかし、感熱フィルムを使用すると、実用化は極め て簡単である。感熱フィルムとは、光ではなく、熱によ って活性化されるフィルムのことである。感熱フィルム うち一部は既に市販されている。特に、極めて高いシャ ープネスを実現でき、しかも減衰を可変化できるものと しては、Kodak社(Rochester、NY)や Imation (以前の3M、St. Paul、MN) の製品がある。Kodak社の製品の商品名はDire ct Digital Thermal Filmで、 Imation (3M) 社の製品はDry Silve r Thermal Filmとして知られている。い ずれの製品の場合も、露光時の熱エネルギーを変えるこ とによってフィルムの光学濃度を調節できる。熱エネル ギーについては、赤外線を放射できるレーザーによって 与えることができる。従って、必要な減衰した均質な可 視光またはUVをフレキソ印刷版のフォトポリマー層の 選択された部分に露光できるだけでなく、この印刷版に 再現される画像の各要素周囲への最適露光量について減 衰量を正確に計算できる。例えば、ImationのD ry Silver ThermalFilmの場合に は、フィルムの特定部分の光学濃度を、当該部分に与え られる熱エネルギーに応じて、0~3の範囲にすること ができる。光学濃度0は光減衰率0%に相当する。光学 濃度が高くなるにつれ、光減衰率も高くなる。但し、**こ** れは光学濃度が、99.9%の光減衰率に相当する3の 値に達するまでである。 (Graphics Tech nologies社、South Hadely、Ma ss) のLasermarkなどの純粋なアプレーショ ン形感熱フィルムではこのようにならない上に、グレー スケールが不可能である。

【0015】一つの実施態様では、従来と同様にして(真空を使用して)、フィルム5を印刷版に保持できる。別な実施態様では、USP5,262,275に記載されているように、フォトポリマー1に直接被覆することによって、フィルム5を印刷版の一体的部分とすることができる。しかし、いずれの場合も、操作は同じである。即ち、マスク5の不透明部8によって遮光した状態で、平行光または非平行光をフォトポリマー1の、マスクが透明な部分に露光する。このフォトポリマー1

は、光7で露光すると、架橋、即ち重合する。露光により重合した部分はすべて弾性レベル2まで達する。光減衰を可変化する調光体9によって、微小なシャドー部への過剰露光がなくなるため、解像度のより高いスクリンを実現できる。

【0016】別な形の露光補正、即ちマスクに組込むこ とができ、そしてマスク5の調光体9と組合わせて使用 した場合に特に有効な露光補正は、近接補正として知ら れている。フォトポリマーの露光工程で発生する収差に 関するこの形の収差補正は、半導体の分野でよく知られ ている収差補正である。ところが、このような方法が印 刷版に適用されたことはなかった。半導体製造における 近接補正に関する一つの論文が、"Microlith ography World"、1996年春季号に発 表されている。これらの効果は、PROLITHとして 知られている一般に利用可能なソフトウエアによってモ デル化することができる。フレキソ印刷版の近接効果を 計算するのに特に有効なのは、このプログラムの最新の バージョン、即ちPROLITH3Dである。簡単な近 接補正の実施例を図3aおよび3bに図示する。図3a では、露光工程時の近接効果を補正するために、マスク 5の部分を意図的に歪めてある。線11が別な線10に 近接している場合には、線11の幅を狭くして、隣接す る線からの漏光による印刷版ポリマーへの露光増大を補 償する。線11の角部を予め鋭い角部に歪めて、散乱漏 光によって生じる角部の円形化を補償する。図3bの場 合、フォトポリマーの線10、11が直線のように見 え、一方マスク5は歪んで見える。仮にマスク5が近接 補正されていないならば、印刷版1の線10、11は歪 んでみえるはずである。例えば、角部は円く見えるはず である。

【0017】図4に示す別な実施態様では、フォトポリ マー工程の解像力以上に極めて微細な面積変調を使用し て、連続グレースケールが可能でないか、あるいは望ま しくない場合に、光を減衰する。例えば、マスク上に透 明部12を囲んで独立した画素網点14を疑似ランダム に分散すると、全体的な光減衰が生じ、個々の網点が再 現されない。この方法はそれ程望ましいとはいえない。 というのは、使用する網点が、例えば10μm以下と極 めて微小でなければならず、また撮像装置としては、解 像度が極めて高い装置のみが使用できるに過ぎないから である。この方法が適用できるのは、グレースケールが 可能でないフィルム5、例えば、Lasermarkや Polaroid's Helios (Polaroi d Graphic Imaging社、Waltha m、MASS) などの感熱フィルムを使用する場合であ る。フレキソ印刷版のマスクの光学濃度を変更するか、 あるいはフィルム上で画素網点などの形を取るランダム 位置において露光時にレーザーエネルギーを調節するこ とによって、フィルム5に調光体9を形成する。

【0018】外側にドラム型レコーダをもつ通常のリソ グラフィー印刷機を使用して、フォトポリマーフレキソ 印刷版で撮像する場合、その第1の工程はマスク製作工 程である。画像の予想される各種歪曲の補正については 手動か、あるいは各種のリソグラフィーシミュレーショ ンソフトウエアを使用してモデル化する。各種歪曲を補 正した画像をデジタル情報に変換し、このデジタル情報 を通常の版セッターに使用して、マスクを撮像する走査 レーザーダイオードによる露光について位置決めし、か つ調節する。フィルムについては、噴霧器やプラズマ蒸 着を使用して、プレプレス機の外部回転撮像シリンダに よって個別に形成するか、あるいはフォトポリマー層上 に被覆すればよい。レーザー撮像ヘッドは、特定量の熱 エネルギーを特定位置に供給することによってモデル化 画像に従ってマスクを撮像する走査赤外線レーザー列を 有する。マスクの撮像終了後、次の工程に移る。即ち、 シリンダからマスクまたはマスクとフォトポリマーを取 り外し、マスクを介して平行紫外線または非平行紫外線 でフォトポリマーを露光する。この工程が終了したなら ば、フレキソ印刷版をリソグラフィー印刷機にセットす る。

[0019]

【実施例】

実施例1

視準放物面反射鏡を使用して、5kWのショートアークランプの下で8分間紫外線をDuPont de Nemours and Company社(Wilmington、DE)製のCyrel PLSタイプのフォトポリマー型フレキソ印刷版に露光した。使用したCyrel版は、(正式名ではないがVolcano Filmとして知られているタイプの)Kodak DirectDigital Thermal Filmで被覆しておいた。また、830nmを使用して3200dpiにおいて、フィルムをTrendsetter3244T(Creo Produts Inc.、Burnaby B.C.、カナダ)で予め露光しておいた。このTrendsetter中でフィルムの透明部のすべてを500mJ/cm2で露光した。シャドー部の微

細な部分の周囲に、(換言すれば、印刷版の非画線部となる、フィルム上の微細な黒色部の周囲に)、幅が約1mmで、UV濃度が半径方向に約0.2から0.1になるリングを残すことによって、光学濃度の低いリングを形成した。即ち、リング縁部において400~500mJ/cm2でフィルム(このフィルムの場合、露光量が多量な程、濃度が低くなる)を露光した。テキスト、線、および1501pi以下のスクリン線を含む画像をこの方法で形成した。版の現像は、通常の方法で行なった。解像力は、調光体がない場合の解像力を越えた。

【0020】実施例2

実施例1の方法および手順に従ったが、線間距離が1mm以下の場合にはすべて線を1画素分だけ狭くすることによって、線幅を他の線に対して近接補正した。他の露光部に対して近接して走っている線の広がりが大幅に減少した。

【図面の簡単な説明】

【図1】フォトポリマーフレキソ印刷版露光時の、従来 例横断面図である。

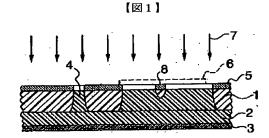
【図2】本発明マスクの横断面図である。

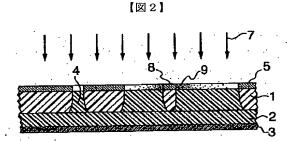
【図3】(a)は近接補正を説明するマスクの上面図である。(b)は(a)に示したマスクによる近接補正後の版を示す図である。

【図4】光減衰を発生するために使用した画素網点を示すマスクの上面図である。

【符号の簡単な説明】

- 1 フォトポリマー層
- 2 弾性層
- 3 支持層
- 5 マスク
- 6 不透明物体
- 7 平行紫外光
- 8 非画線部
- 9 調光体
- 10 線
- 11 線
- 12 透明部
- 14 画素網点





[図3] (.a)

